**文章编号:** 0258-7025(2009)02-0449-04

# 纳米 SiO<sub>2</sub> 基质中 Eu<sup>3+</sup> 的发光特性

江 东1 胡晓云1 苗仲海1 王永强1,2 潘 静1 刘国敬1

(1西北大学物理学系,陕西西安 710069;2河南理工大学理化系,河南 焦作 454000)

摘要 采用溶胶-凝胶法(sol-gel)制备了 Eu<sup>3+</sup>掺杂 SiO<sub>2</sub> 基质发光材料,分别用荧光(PL)光谱、原子力显微镜 (AFM)、扫描电镜(SEM)等分析手段对样品进行了表征,研究了退火温度以及掺杂浓度对发射光谱的影响,并对其 发光机制进行了分析。薄膜样品在 258 nm 光激发下,在 620 nm,667 nm 处出现了比较少见的双峰红光发射,而 620 nm 处的光发射最强,说明 Eu<sup>3+</sup>离子处在对称性较低的配位环境中。退火处理温度对样品的发射光谱影响很 大,经 900 ℃退火处理的样品发射强度最强。随着掺杂浓度的变化,改变了 Eu<sup>3+</sup> - O<sup>2-</sup>间的距离,在相同紫外光激 发下 O<sup>2-</sup>外层的电子迁移到 Eu<sup>3+</sup> 4*f* 轨道上的能量变化,使得谱线位置出现了移动。

关键词 材料;发光特性;溶胶-凝胶法;稀土;SiO2

中图分类号 O482.31; O614.33; O484 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL20093602.0449

# Luminescent Properties of Eu<sup>3+</sup> in Nano-Matrix of SiO<sub>2</sub>

Jiang Dong<sup>1</sup> Hu Xiaoyun<sup>1</sup> Miao Zhonghai<sup>1</sup> Wang Yongqiang<sup>1,2</sup> Pan Jing<sup>1</sup> Liu Guojing<sup>1</sup> <sup>1</sup>Department of Physics, Northwest University, Xi'an, Shaanxi 710069, China <sup>2</sup>Department of Physics and Chemistry, Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454000, China

**Abstract**  $\operatorname{Eu}^{3+}$ -doped SiO<sub>2</sub> matrix materials were prepared by sol-gel technique. The samples were characterized by the modern analysis techniques such as the fluorescence spectrum, atomic force microscope (AFM) and scanning electron microscope (SEM) and so on. The influences of annealing temperature and doping concentration on the luminescent properties were studied systematically, and the luminescence mechanism was investigated. When the films were excited at 258 nm, double peak at 620 nm and 667 nm were observed, which was rarely seen, and at 620 nm the emission intensity reached the strongest, which suggested  $\operatorname{Eu}^{3+}$  ions lay in the coordination environment of the lower symmetry. The annealing temperature made great effect on the emission spectroscopy, the luminescence intensity of the film annealed at 900 °C was the strongest. With the variations of doping concentration, the distance between  $\operatorname{Eu}^{3+}$  and  $\operatorname{O}^{2-}$  migrated to the 4*f* orbit of  $\operatorname{Eu}^{3+}$  caused the energy changed, and the spectrum position removed.

Key words materials; luminescent properties; sol-gel method; rare earths; SiO<sub>2</sub>

1 引

近年来,随着纳米技术的发展及显示技术的提高,人们加快了对薄膜显示和其光学性能的研究<sup>[1,2]</sup>。由于 Eu<sup>3+</sup>的特征发射谱线位于红色光区, 这些谱线在发光与显示中有着重要的应用<sup>[3,4]</sup>。另 外,SiO<sub>2</sub> 玻璃具有低的热膨胀系数、高的机械强度 和良好的化学稳定性,可作为各种光学滤色片的基 质材料<sup>[5,6]</sup>。因此,Eu<sup>3+</sup>掺杂的纳米氧化硅基发光 材料由于具有较高的发光量子效率和较好的光谱特 性,为平板显示、照明领域等的应用提供了更为广阔 的空间<sup>[7]</sup>。

本文采用溶胶-凝胶法制备了 Eu<sup>3+</sup> 掺杂纳米

收稿日期: 2008-08-26; 收到修改稿日期: 2008-10-15

基金项目:西北大学研究生自主创新项目(07YZZ019)、国家自然科学基金(20876125)和陕西省教育厅科技计划(08JK451)资助课题。

作者简介: 江 东(1980-),男,硕士研究生,主要从事发光材料和发光薄膜等方面的研究。

E-mail: jiangdong2006@126.com

言

**导师简介:**胡晓云(1959-),女,博士,教授 主要从事发光材料及薄膜物理等方面的研究。E-mail: hxy3275@nwu.edu.cn (通信联系人) SiO<sub>2</sub> 材料,研究了退火温度和掺杂浓度对薄膜样品 发光性质的影响,并对其发光机制进行了探讨。

#### 2 实 验

### 2.1 制备

准确称取配制一定量加入硼酸(H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>)的 SiO<sub>2</sub>前驱溶液,溶液呈透明。向配制好的溶液中分 别加入原子数分数为 0.5%,0.4%,0.3%,0.2%的 Eu(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> • 6H<sub>2</sub>O 和 0.2%的 Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O, 搅拌 4 h,将溶液陈化 48 h 后,制得溶胶。将硅片用 去离子水清洗干净,用无水乙醚将洗净的硅片擦拭 干净,用 KW-4A 型台式匀胶机以 3 kr/min 的匀胶 速度镀膜。将镀好的薄膜置于干燥箱,在 80 ℃下干 燥 15 min。将薄膜在马福炉中以不同温度退火处 理 2 h,制得样品。

#### 2.2 表征与测试

采用 AJ-Ⅲ原子力显微镜(AFM)分析表面形貌; 采用 JIM-6700 冷场发射扫描电子显微镜(SEM)对样 品的表面和结构进行表征;采用 WGY-10 型紫外-可 见荧光分光光度计测量激发光谱与发射光谱。

## 3 结果和讨论

#### 3.1 微观结构分析

图1给出了900 ℃退火处理薄膜样品的表面形 貌(放大6万倍),从图中可以看出薄膜样品致密、均 匀、无明显的缺陷。为了进一步观察薄膜的微观结 构,采用原子力显微镜测试其表面形貌如图2所示, 结果表明膜层表面平均粗糙度(RA)为0.003 nm, 均方根(RMS)表面粗糙度为0.044 nm,测试截面膜 的RA为0.00302 nm,RMS为0.00474 nm,表面起 伏为1.207 nm,可见膜层的表面均匀性良好,颗粒 尺寸分布均匀。一般情形,减少晶粒缺陷、颗粒分散 均匀和大的比表面积有利于提高发光性能<sup>[8,9]</sup>。



图 1 900 C退火薄膜样品扫描电镜图 Fig. 1 SEM photograph of 900 C annealing temperature of film by spin-coating





Fig. 2 AFM three-dimensional picture of 900 °C annealing temperature of film by spin-coating

#### 3.2 退火温度对发光性能的影响

在发光与显示领域中 Eu<sup>3+</sup>的特征发射谱线有 许多重要的应用<sup>[10,11]</sup>。文献[12]中提到当 Eu<sup>3+</sup>处 于严格反演对称中心格位时,Eu<sup>3+</sup>的发射以允许的  ${}^{5}D_{0}$ → ${}^{7}F_{1}$  磁偶极跃迁为主;当 Eu<sup>3+</sup> 处于偏离反演 对称中心格位时,由于  $Eu^{3+}$ 的  $4f^{6}$  电子组态中混入 了相反宇称的组态,使得 $^{5}D_{0} \rightarrow ^{7}F_{2}$ 电偶极跃迁成为 允许的跃迁。图 3 给出了 900 ℃退火温度下 Eu<sup>3+</sup> 掺杂原子数分数为 0.5%的 SiO2 薄膜的激发光谱, 监控波长为 618 nm,在 258 nm 处呈现强的激发峰。 经不同退火温度处理的薄膜的发射光谱如图 4 所 示,经900℃热处理的样品出现了3条谱线分别是 518 nm  $({}^{5}D_{2} \rightarrow {}^{7}F_{3})$ , 620 nm, 667 nm  $({}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{3})$ , 主峰位于 620 nm,归属于 Eu<sup>3+</sup> 的<sup>5</sup>D<sub>0</sub>  $\rightarrow$  <sup>7</sup>F<sub>2</sub> 超灵敏 跃迁,说明 Eu<sup>3+</sup> 处于偏离反演中心的格位,属于电 偶极跃迁,可推测 Eu<sup>3+</sup>离子在对称性较低的配位环 境中。在图 4 中出现了在一般基质环境中很难见到 的双峰结构(620 nm,667 nm),两峰的强度比较接 近。以相同溶胶制备的干凝胶的发射光谱如图 5 所 示,呈现明显的单峰结构。说明基质溶胶与硅片在 热处理过程中充分键合,使得基质环境发生了变化, 而这种薄膜的基质环境相对于干凝胶样品的环境更



图 3 900 ℃退火处理的薄膜的激发光谱 Fig. 3 900 ℃ annealing temperature on excitation spectra of film

451

适宜 667 nm ( ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{3}$ )处的光发射,如果进一步细 化工艺条件,有可能制备出在 667 nm 附近的强红光 薄膜样品。



图 4 不同退火温度处理的薄膜的发射光谱 Fig. 4 Influence of annealing temperature on emission spectra of films

从图 4 可以看出,随着退火温度的增加发光强度 先增强后减弱,经 900 ℃退火处理的样品<sup>5</sup> $D_0 \rightarrow$ <sup>7</sup> $F_2$ 发射最强,而 950 ℃退火处理的样品光强最弱。这 可能是由于随着退火温度升高,非晶 SiO<sub>2</sub> 尺寸不断 增大,缺陷态对电子-空穴载流子俘获的数量迅速减 少,导致 Eu<sup>3+</sup>离子所处的配位环境的对称性进一步 降低,不利于光发射。





#### 3.3 掺杂浓度对发光性能的影响

图 6 是不同 Eu<sup>3+</sup> 掺杂浓度的 SiO<sub>2</sub> 薄膜的发射 光谱,可以看出,随着掺杂浓度的变化谱线的峰位出 现了移动。随着掺杂浓度的增加发射强度先增强后 减弱,出现了浓度猝灭现象。随着掺杂量的变化谱 线出现了红移和蓝移现象(相对于掺杂原子数分数 为 0.3%)。当掺杂原子数分数为 0.4%时主峰蓝移 了 10 nm,随着掺杂原子数分数数 0.4%时主峰蓝移 了 10 nm,随着掺杂原子数分数路续增大到 0.5%谱 线出现红移大约 4 nm。这可能是由于 Eu<sup>3+</sup>离子浓 度的变化,改变了 Eu<sup>3+</sup>  $- O^{2^-}$ 间的距离,在相同紫 外光激发下  $O^{2^-}$ 外层的电子迁移到 Eu<sup>3+</sup> 4f 轨道上 的能量变化,使得谱线位置出现了移动<sup>[13]</sup>。当掺杂 原子数分数为0.4%时, $Eu^{3+}-O^{2-}$ 间的距离变短, 紫外光激发下 $O^{2-}$ 外层的电子迁移到 $Eu^{3+}4f$ 轨道 上的能量升高,导致谱线蓝移。当掺杂原子数分数 为0.5%时, $Eu^{3+}$ 间的位置靠近,经高温热处理稀土 离子更易发生位置迁移形成团簇, $Eu^{3+}-O^{2-}$ 间的 距离变长,紫外光激发下 $O^{2-}$ 外层的电子迁移到  $Eu^{3+}4f$ 轨道上的能量降低,导致谱线红移。



图 6 不同掺杂浓度 900 ℃热处理样品的发射光谱 Fig. 6 Influence of doping concentration on emission spectra of films

对于 Eu<sup>3+</sup> 的<sup>5</sup>D<sub>0</sub> 和<sup>5</sup>D<sub>2</sub> 激发态能级的辐射跃 迁,随着 Eu<sup>3+</sup>掺杂浓度的增加,<sup>5</sup>D<sub>0</sub>→<sup>7</sup>F<sub>2</sub> 跃迁的发 射强度和<sup>5</sup>D<sub>2</sub>→<sup>7</sup>F<sub>3</sub> 跃迁的发射强度先增加后减弱。 这可能是由于 Eu<sup>3+</sup>浓度增加导致发光中心增多,但 是随着掺杂浓度的增加,Eu<sup>3+</sup> 间的位置靠近,从而 使得离子间的能量传递加剧,使部分激发能通过基 质网格迁移而消耗掉了,导致发光强度的下降<sup>[14]</sup>。

# 4 结 论

用溶胶-凝胶法制得的掺 Eu<sup>3+</sup> 薄膜样品,在 258 nm 光激发下在 620 nm,667 nm 处有比较少见 的双峰红光发射,而 620 nm 处的光发射最强,说明 Eu<sup>3+</sup>离子处在对称性较低的配位环境中。退火处 理温度对样品的发射光谱影响很大,经 900 ℃退火 处理的样品发射强度达到最大。且随着掺杂浓度的 变化,改变了 Eu<sup>3+</sup> - O<sup>2-</sup> 间的距离,在相同紫外光 激发下 O<sup>2-</sup> 外层的电子迁移到 Eu<sup>3+</sup> 4*f* 轨道上的能 量变化,使得谱线位置出现了移动。

#### 参考文献

胡远荣,王丽阁,李国卿等. 磁控溅射法制备钛掺杂 WO3 薄膜结

<sup>1</sup> Hu Yuanrong, Wang Lige, Li Guoqing *et al.*. Structure and properties of Ti-doped WO<sub>3</sub> films prepared by magnetron sputtering method[J]. Acta Optica Sinica, 2007, 27(3): 559~ 562

构和性能的研究[J]. 光学学报, 2007, 27(3): 559~562

- 2 Yang Zhiping, Liu Yufeng, Wang Liwei et al.. Luminesce properties of the single white emitting phosphor Eu<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup> codoped Ca<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> \* [J]. Acta Physica Sinica, 2007, 56(1): 0546~0550
- 3 Miura N, Kawanishi M, Matsumato H et al.. High luminance blue-emitting BaAI<sub>2</sub>S<sub>1</sub>: Eu thin-film electroluminescent devices [J]. Jpn. J. Appl. Phys., (Part 2), 1999, 38(IIB): 1291~ 1292
- 4 An Baoti, Gong Menglian, Ye Jianqing *et al.*. Synthesis and fluorescence of novel conjugated europium complex[J]. *J. Rare Earths*, 2003, **5**(21): 514~518
- 5 Wang Yanzhi, Zheng Wili, Fan Zhengxiu *et al.*. Analysis for acurrately fitting the refractive index of SiO<sub>2</sub> thin film [J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, **35**(5): 760~763 王胭脂,张伟丽,范正修等. SiO<sub>2</sub> 薄膜折射率的准确拟合分析 [J]. 中国激光, 2008, **35**(5): 760~763
- 6 Song Chunfeng, Yang Ping, Lü Mengkai et al.. Effect of preparation technology parameters on the photoluminescence properties of silica xerogel[J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2003,(2): 89~92

宋春风,杨 萍,吕孟凯等.制备工艺条件对 SiO<sub>2</sub> 干凝胶发光性 质的影响[J]. 硅酸盐通报,2003,(2):89~92

- 7 M. Ohta , M. Yasuda, M. Takami. Thermoluminescence properties of SiO<sub>2</sub>:Al, Eu[J]. J. Alloys and Compounds, 2000, 303~304; 320~324
- 8 Luo Wenxiong, Huang Shihua, You Fangtian et al.. The luminescent properties of YBO<sub>3</sub>: Eu<sup>3+</sup> nanocrystal [J]. Acta Physica Sincia, 2007, 56(3): 1765~1769

罗文雄,黄世华,由芳田 等. YBO3:Eu3+纳米晶发光特性[J]. 物

理学报,2007,56(3):1765~1769

光

- 9 Zhang Ping, Li Lingxia, Xu Mingxia. A red luminescence nanocrystallite of Sr<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>2+</sup> new morphology and luminescence properties [J]. *Chinese J. Inorganic Chemistry*, 2007, 23(9): 1679~1682
  张 平,李玲霞,徐明霞, Sr<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>2+</sup>红色纳米晶的新型形貌
- 与发光性能的研究[J]. 无机化学学报,2007,23(9):1679~1682
- 10 Yunfeng Ding, Hui Min, Xibin Yu. New Eu-doped phosphor prepared by sol-gel process[J]. Materials Lett., 2004, 58: 413~ 416
- 11 A. Biswas, C. S. Friend, G. S. Maciel *et al.*. Optical properties of europium doped gels during densification [J]. J. Non-Crystalline Solids, 2000, 261: 9~14
- 12 Hu Xiaoyun, Fan Jun, Bai Jintao et al.. Enhanced emission of Eu<sup>3+</sup> in boron ions doped sol-gel SiO<sub>2</sub> phosphors[J]. J. Chinese Rare Earth Societ, 2005, 23(6): 695~699 胡晓云,樊 君,白晋涛等. 硼离子对 Eu 掺杂 SiO<sub>2</sub> 干凝胶发光 性能的影响[J]. 中国稀土学报, 2005, 23(6): 695~699
- 13 Fu Shiliu, Yin Tao, Chai Fei. Solid state reaction mechanism and luminescence of Eu<sup>3+</sup> doped Ca<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub> phosphor[J]. J. Inorganic Materials, 2007, 22(4): 647~651
  符史流,尹 涛,柴 飞. Ca<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub>:Eu<sup>3+</sup>的固相反应形成机理及 发光性质研究[J]. 无机材料学报, 2007, 22(4): 647~651
- 14 Chen Zhe, Xie Hong, Yan Youwei. Influence of Eu<sup>2+</sup> content on the spectral characteristics of BaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>: Eu<sup>2+</sup> phosphor[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2007, 27(4): 657~659 陈 哲,谢 鸿,严有为. Eu<sup>2+</sup>掺杂浓度对 BAM 光谱特性的影响[J]. 光谱学与光谱分析, 2007, 27(4): 657~659